

## EV GROUP ADVANCES LEADERSHIP IN OPTICAL LITHOGRAPHY WITH NEXT-GENERATION EVG150 RESIST PROCESSING PLATFORM – November 8, 2022

EV Group (EVG) today announced that it has strengthened its portfolio of optical lithography solutions with the unveiling of the next-generation 200-mm version of its EVG®150 automated resist processing system. The redesigned EVG150 platform includes advanced features and enhancements that provide even greater throughput (by up to 80 percent) and versatility, as well as smaller tool footprint (by nearly 50 percent), compared to the previous-generation platform.



## 通用平台具有前所未有的灵活性

下一代EVG150用于200毫米基板,保持了上一代平台领先于行业的先进功能,包括:全自动平台,配备可定制模块,用于控流、喷涂、墨影、烘烤和冷却;采用EV 集团专有OmniSpray率技术,用于极端匿形的保形涂层;经过现场验证的复杂的机 能人操作,具有双端执行器功能,可确保持续宽产量;能够处理晶圆边缘、弯曲、翘曲和瑞晶圆。



下一代EVG®150自动抗党制处理系统保持了上一代平台领先于行业的先进功能、同时新增了一些银代化功能。 有效损升产量(损升磁度施达80%),改进通用性、减少设备占用面积(减少近50%)。

下一代EVG150 200毫米平台的新功能包括:

- 多达四个湿处理模块空间,多达20个烘烤/冷却单元,可同时处理多个晶片
- 单涂层室,可完全隔离模块,几乎完全避免了模块之间的交叉污染
- 全新设计模块,便于从系统外部进入各个腔室,最大限度地减少停机时间,可以在进行腔室维护的同时继续操作设备
- 重新定位平台内部的腔室,便于接近机器人操控单元,使维护更简单
- 配备基于图像的预调准器,实时完成晶圆定心,提高处理速度
- 系统内部集成抗蚀剂和化学线,减少储存化学品的外部机柜空间,减少设备占地面积
- 系统内部集成用户接口,进一步减少设备占用空间

EV集团公司技术总监托马斯·格林斯纳博士 (Thomas Glinsner) 介绍说: "抗蚀剂 处理和图案成形是半导体制造中重复最多的工艺步骤。EV集团在这方面积累了丰富 经验,包括光刻,整涂和喷涂,能够满足最苛刻的客户要求,我们已将这些经验融入 下一代EVG150系统,该系统经过全新设计,能够在通用平台中实现突破性的高产 量,帮助客户实现极具优势的拥有成本。这种通用平台具有出色的灵活性,能够满足 多种抗蚀剂工艺需求。"

## 产品上市信息

EV集团已开始接收下一代EVG150自动抗蚀剂处理系统订单,并在EV集团总部演示产品。

## 关于 EV 集团(EVG)

EV集团 (EVG) 是为半导体、微机电系统 (MEMS)、化合物半导体、功率器件和 纳米技术器件制造提供设备与工艺解决方案的感先供应施。主要于品包括:品圆键 含、海晶圆处理、光刻/光刻纳米压印 (NIL) 与计量设备,以及光刻胶涂布机、清洗 机和检测系统。EV集团成立于1980年,可为全球各地的客户和合作伙伴网络提供服 务与支持。